BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KULTUS

Vorläufige Lehrplanrichtlinien für die Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

Unterrichtsfächer: Englisch

Halbleiter- und Mikrosystemtechnik

Fertigungstechnologie

Chemische Prozesse

Jahrgangsstufen 10 bis 12

Dezember 1998

Die vorläufigen Lehrplanrichtlinien wurden mit KMBek vom 5. August 1999 Nr. VII/6-S9414M10-1-14/83153 in Kraft gesetzt. Sie gelten mit Beginn des Schuljahres 1999/2000.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	
EINFÜHRUNG		
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule Ordnungsmittel und Stundentafel Leitgedanken für den Unterricht an Berufsschulen Aufbau der vorläufigen Lehrplanrichtlinien, Verbindlichkeit Übersicht über die Fächer und Lerngebiete Berufsbezogene Vorbemerkungen	1 2 5 6 6 8	
LEHRPLÄNE		
Englisch Halbleiter- und Mikrosystemtechnik Fertigungstechnologie Chemische Prozesse	9 11 17 28	
Anlagen: Mitglieder der Lehrplankommission Verordnung zur Berufsausbildung	35	

EINFÜHRUNG

1 Bildungs- und Erziehungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule hat gemäß Art. 11 BayEUG die Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern berufliche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu vermitteln. Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen dabei in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bildungsauftrag.

Die Aufgabe der Berufsschule konkretisiert sich in den Zielen,

- eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art verbindet,
- berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln,
- die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken,
- die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen Leben verantwortungsbewusst zu handeln.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

- den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung betont;
- unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende Qualifikationen vermitteln;
- ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und der Gesellschaft gerecht zu werden;
- auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefahren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht, und soweit es im Rahmen berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf die Kernprobleme unserer Zeit eingehen, wie z. B.

- Arbeit und Arbeitslosigkeit,
- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung ihrer jeweiligen kulturellen Identität,
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie
- Gewährleistung der Menschenrechte.

2 Ordnungsmittel und Stundentafel

Den vorläufigen Lehrplanrichtlinien¹ liegen der Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Mikrotechnologe/Mikrotechnologin - Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 30.1.98 - und die Verordnung über die Berufsausbildung für den Ausbildungsberuf Mikrotechnologe/Mikrotechnologin vom 6.3.98 (BGBl I, S. 477) zugrunde.

Der Ausbildungsberuf Mikrotechnologe/Mikrotechnologin ist ein Monoberuf. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

¹Vorläufige Lehrplanrichtlinien unterscheiden sich von herkömmlichen Lehrplänen darin, dass die Formulierungen der Lernziele und Lerninhalte aus den KMK-Rahmenlehrplänen im Wesentlichen unverändert übernommen werden.

Stundentafel

Den vorläufigen Lehrplanrichtlinien liegt die folgende Stundentafel zugrunde:

Pflichtunterricht:1

Blockunterricht

Blockwochen	Jgst. 10 12	Jgst. 11 12	Jgst. 12 9
Allgemein bildender Unterricht:			
Religionslehre	3	3	3
Deutsch	4	3	3
Politik und Gesellschaft	4	3	3
Sport	2	2	2
Fachlicher Unterricht:			
Englisch	3	3	3
Halbleiter- und Mikrosystemtechnik	7	9	9
Fertigungstechnologie	10	10	10
Chemische Prozesse <u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	
Zusammen	39	39	39

Wahlunterricht (bis zu 2 Stunden je Fach)²

gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung

Welche Lehrpläne für den weiteren Pflichtunterricht und für den Wahlunterricht gelten, geht aus dem Lehrplanverzeichnis des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in seiner jeweils gültigen Fassung hervor.

Pflichtunterricht:

Einzeltagesunterricht

Unterrichtswochen	Jgst. 10 38	Jgst. 11 38	Jgst. 12 38
Allgemein bildender Unterricht:			
Religionslehre	1	1	1
Deutsch	1	1	1
Politik und Gesellschaft	1	1	1
Sport	-	-	-
Fachlicher Unterricht:			
Englisch	1	-	1
Halbleiter- und Mikrosystemtechnik	3	2	2
Fertigungstechnologie	4	2	2
Chemische Prozesse <u>2</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	
Zusammen	13	9	9

Wahlunterricht (bis zu 2 Stunden je Fach)²

Welche Lehrpläne für den weiteren Pflichtunterricht und für den Wahlunterricht gelten, geht aus dem Lehrplanverzeichnis des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in seiner jeweils gültigen Fassung hervor.

gemäß BSO in der jeweils gültigen Fassung

3 Leitgedanken für den Unterricht an Berufsschulen

Lernen hat die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit zum Inhalt und zum Ziel. Geplantes schulisches Lernen erstreckt sich dabei auf vier Bereiche:

- Aneignung von Wissen, was die Bildung eines guten und differenzierten Gedächtnisses einschließt;
- Einüben von manuellen bzw. instrumentellen Fertigkeiten und Anwenden einzelner Arbeitstechniken, aber auch gedanklicher Konzepte;
- produktives Denken und Gestalten, d. h. vor allem selbstständiges Bewältigen berufstypischer Aufgabenstellungen;
- Entwicklung einer Wertorientierung unter besonderer Berücksichtigung berufsethischer Aspekte.

Diese vier Bereiche stellen Schwerpunkte dar, die einen Rahmen für didaktische Entscheidungen, z. B. über Art und Umfang der Inhalte und der geeigneten unterrichtlichen Methoden, geben. Im konkreten Unterricht werden sie oft ineinander fließen.

Die enge Verknüpfung von Theorie und Praxis ist das grundsätzliche didaktische Anliegen der Berufsausbildung. Für die Berufsschule heißt das: Theoretische Grundlagen und Erkenntnisse müssen praxisorientiert vermittelt werden und zum beruflichen Handeln befähigen. Neben der Vermittlung von fachlichen Kenntnissen und der Einübung von Fertigkeiten sind im Unterricht überfachliche Qualifikationen anzubahnen und zu fördern.

Lernen wird erleichtert, wenn der Zusammenhang zur Berufs- und Lebenspraxis immer wieder deutlich zu erkennen ist. Dabei spielen konkrete Handlungssituationen, aber auch in der Vorstellung oder Simulation vollzogene Operationen sowie das gedankliche Nachvollziehen und Bewerten von Handlungen anderer eine wichtige Rolle. Methoden, die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind besonders geeignet und sollten deshalb in der Unterrichtsplanung angemessen berücksichtigt werden. Handlungskompetenz wird verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dieses Konzept lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Im Unterricht ist zu achten auf

- eine sorgfältige und rationelle Arbeitsweise,
- Sparsamkeit beim Ressourceneinsatz,
- die gewissenhafte Beachtung aller Maßnahmen, die der Unfallverhütung und dem Umweltschutz dienen,
- sorgfältigen Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift.

Im Hinblick auf die Fähigkeit, Arbeit selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren, sind vor allem die bewusste didaktische und methodische

Planung des Unterrichts, die fortlaufende Absprache der Lehrer für die einzelnen Fächer bis hin zur gemeinsamen Planung fächerübergreifender Unterrichtseinheiten erforderlich. Darüber hinaus ist im Sinne einer bedarfsgerechten Berufsausbildung eine kontinuierliche personelle, organisatorische und didaktisch-methodische Zusammenarbeit mit den anderen Lernorten des dualen Systems sicherzustellen.

4 Aufbau der vorläufigen Lehrplanrichtlinien, Verbindlichkeit

Die Ziele und Inhalte der vorläufigen Lehrplanrichtlinien bilden zusammen mit den Prinzipien des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung des Freistaates Bayern und des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen die verbindliche Grundlage für den Unterricht und die Erziehungsarbeit. Im Rahmen dieser Bindung trifft der Lehrer seine Entscheidungen in pädagogischer Verantwortung.

Die Ziele und Inhalte der vorläufigen Lehrplanrichtlinien werden in der Reihenfolge behandelt, die sich aus der gegenseitigen Absprache der Lehrkräfte zur Abstimmung des Unterrichts ergibt; die in den vorläufigen Lehrplanrichtlinien gegebene Reihenfolge innerhalb einer Jahrgangsstufe ist nicht verbindlich. Die Zeitrichtwerte sind als Anregungen gedacht.

5 Übersicht über die Fächer und Lerngebiete

Die Zahlen in Klammern geben Zeitrichtwerte an, d. h. die für das betreffende Lerngebiet empfohlene Zahl von Unterrichtsstunden.

Jahrgangsstufe 10

Englisch (36) 36	Halbleiter- und Mikrosystemtechnik 10.1 Erfassung und Darstellung von Signalverarbeitungs- vorgängen und elektri- schen Grundgrößen 84	Fertigungstechnologie 10.1 Funktionsanalyse ausgewählter Halbleiterwerkstoffe 10.2 Einhaltung von Reinraumbedingungen 10.3 Anwendung von Standardsoftware 10.4 Fertigstellung mikrotechnischer Produkte I 120	Chemische Prozesse 10.1 Beurteilung von chemischen Zusammenhängen für die Halbleiterherstellung 72	1
<u>Englisch</u> (36) 36	Halbleiter- und Mikrosystemtechnik 11.1 Vergleich von Funktionseinheiten diskreter und integrierter Schaltungen I 108	Fertigungstechnologie 11.1 Anwendung fototechnischer Verfahren in der Mikrotechnologie 11.2 Erstellen von Schichten und deren Strukturierung 11.3 Einhaltung von Qualitätskontrollen 11.4 Einstellung, Prüfung und Optimierung verfahrenstechnischer Anlagen I 120	Chemische Prozesse 11.1 Anwendung fototechnischer Verfahren in der Mikrotechnologie 11.2 Erstellen von Schichten und deren Strukturierung 72	!

Jahrgangsstufe 12

Englisch (27)	Halbleiter- und Mirkosystemtechnik 12.1 Vergleich von Funktions-	Fertigungstechnologie 12.1 Veränderung der Leitfähig-	<u>Chemische Prozesse</u> 12.1 Veränderung der Leitfähig-	
27	einheiten diskreter und in-	keit durch Dotierungsver- fahren	keit durch Dotierungsver- fahren	
	tegrierter Schaltungen II			1
	12.2 Beschreibung von Mikrosystemen	12.2 Fertigstellung mikrotechnischer Produkte II	12.2 Fertigstellen mikrotech- nischer Produkte III	!
	81	12.3 Einstellung, Prüfung und	54	
		Optimierung verfahrens-		
		technischer Anlagen II	!	
		90		

6 Berufsbezogene Vorbemerkungen

"Der Beruf "Mikrotechnologe/Mikrotechnologin" ist der erste duale Ausbildungsberuf für die Chip-Industrie. Die dreijährige Ausbildung erfolgt in den Schwerpunkten "Halbleitertechnik" und "Mikrosystemtechnik". Mikrotechnologen haben ihren Arbeitsplatz in der Produktion und in deren Infrastrukturbereichen sowie in den Forschungs- und Entwicklungslabors von Betrieben, Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Unter Beachtung von logistischen, verfahrenstechnischen und qualitätssichernden Aspekten stellen sie dort Halbleiter und Mikrosysteme nach Fertigungsvorschriften als Prototyp, in Kleinserie oder in Großserien her. Sie planen und organisieren Versuchsreihen, führen sie durch und dokumentieren die Ergebnisse. Außerdem installieren sie Anlagen, Geräte und Apparaturen, stellen die Prozessparameter ein und überwachen die Prozesse. Zur Tätigkeit gehören darüber hinaus die Überprüfung der Funktionsfähigkeit von Fertigungsanlagen einschließlich der Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen sowie die Durchführung von vorbeugenden Instandhaltungsmaßnahmen und die Fehlersuche."

Zitat BIB-Berlin, Ausbildungsberufe

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologie/Mikrotechnologin

ENGLISCH, Jahrgangsstufen 10 - 12

Für das Fach Englisch gilt der Lehrplan für die Berufsschule: Englisch für gewerblich-technische Berufe, Juni 1997.

Dieser Lehrplan enthält neben berufsübergreifenden Lerninhalten (im Teil A des Lehrplans) auch berufsspezifische Lerninhalte, die im Lehrplanteil B ("Berufsspezifische Lerninhalte: Übersichten über Themen, Texte und Schriftstücke") gesondert aufgelistet sind. Diese Lerninhalte sollten - in Absprache mit den Fachlehrkräften - stets in zeitlicher Abstimmung mit entsprechenden Lerninhalten des fachlichen Unterrichts, zusätzlich auch integrativ in den Fächern Halbleiter und Mikrosystemtechnik, Fertigungstechnologie und Chemische Prozesse vermittelt werden.

Die folgende Seite stellt die Ergänzungsseite für die Mikrotechnologen/Mikrotechnologinnen zum o. g. Lehrplan dar. Sie sollte herausgetrennt und dem Englischlehrplan angeheftet werden.

Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

LG 1: Themen wie Gestaltung von Texten, Tabellen und Grafiken

Datenverwaltung und -sicherung (z. B. Backup-Methoden)

Datenschutz

Elemente und Funktionen eines Mikrosystems Kenngrößen von Schaltungen und Schaltelementen Isolieren und Verbinden der Schaltelemente eines IC

elektrische Prüfverfahren

Elemente, Vor- und Nachteile fototechnischer Verfahren

Gesundheits- und Umweltschutz, Entsorgung von Gefahrenstoffen

Herstellung und Strukturierung von Schichten

Planung von Versuchsreihen

LG 2: Texte wie Datenblätter

Beschriftungen auf Chemikalien und technische Anleitungen

Bedienungsanleitungen für Maschinen und Geräte

Handbücher/"Manuale"1

Schaltpläne Ablaufpläne

LG 3: Schriftstücke/

Schreibanlässe wie Wartungs- und Fehlerprotokolle

Arbeitspläne

Tätigkeitsnachweise

In jedem Lernjahr sollten ca. 60 % der Unterrichtszeit auf das LG 1, ca. 30 % auf das LG 2 und ca. 10 % auf das LG 3 verwendet werden.

besonders zu empfehlen: Peter von Zant, Microchip Fabrication: A Practical Guide to Semiconductor Processing. Semiconductor Services San Jose, CA, USA, 1984 ISBN 0-9613880-1-3

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

HALBLEITER- UND MIKROSYSTEMTECHNIK, Jahrgangsstufe 10

Lerngebiet: 10.1 Erfassung und Darstellung von Signalverarbeitungsvorgängen und elektrischen Grundgrößen

84 Std. 84 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
10.1 Erfassung und Darstellung von Signalverarbeitungsvorgängen und elektrischen		In diesem Lerngebiet soll die Technische Mathematik besonders berücksichtigt werden.
Grundgrößen		84 Std.
Die Schüler und Schülerinnen untersuchen und bestimmen die Zusammenhänge zwischen den	Elektrische Größen, deren Zusammenhänge und Darstellungsmöglichkeiten	
Grundgrößen der Elektrotechnik und wenden diese auf elektrische	Analoge und digitale Signale	
Grundschaltungen an. Sie unter-	Messmethoden zur Erfassung elektrischer	
scheiden zwischen analogen und digitalen Signalen und ordnen diese	Größen	
den unterschiedlichen Einsatzgebieten zu. Sie beherrschen die	Funktion und Aufbau passiver Bauelemente	

einschlägigen Verfahren zur Messung von elektrischen Größen und werten die gewonnenen Ergebnisse. Sie untersuchen das Verhalten von passiven Bauelementen im Gleich- und Wechselstromkreis. Sie halten die einschlägigen Vorschriften ein.

Schutzbestimmungen, Schutzmaßnahmen, Sicherheitsregeln

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

HALBLEITER- UND MIKROSYSTEMTECHNIK, Jahrgangsstufe 11

Lerngebiet: 11.1 Vergleich von Funktionseinheiten diskreter und integrierter Schaltungen I <u>108 Std.</u>

108 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
11.1 Vergleich von Funktionseinheiten diskreter und integrierter Schaltungen I		In Verbindung mit dem LG 12.1 In diesem Lerngebiet soll die Technische Mathematik besonders berücksichtigt werden. 108 Std.
Die Schüler und Schülerinnen un- tersuchen die elektrische Wirkung von Schaltelementen diskreter und	Aufbau, Wirkungsweise und Eigenschaften passiver und aktiver Schaltelemente	
integrierter Schaltungen. Sie ver- wenden dazu Datenblätter in deut-	Bipolare und unipolare Technik	
scher und englischer Sprache. Sie bauen einfache Schaltungen der	Grundschaltungen der Verstärkertechnik	
Analog- und Digitaltechnik auf und erklären deren Funktion. Sie	Logische Grundschaltungen, Speicherzellen	

messen und dokumentieren die elektrischen Kenngrößen von Schaltelementen und Schaltungen, wie sie zur Prüfung von Wafern verwendet werden (Teststrukturen). Sie erklären den geometrischen und physikalischen Aufbau sowie dessen Einfluss auf die Eigenschaften der Schaltelemente. Sie bewerten die Stabilität der Schaltelemente. Sie beschreiben die erforderlichen Technologien, die beim Zusammenschalten einzelner Schaltelemente zum IC angewandt werden.

Bestimmung von Widerstand, Kapazität, Sperrstrom, Stromverstärkung, Steilheit, Schaltzeiten und Grenzfrequenz

Empfindlichkeit gegenüber physikalischen und chemischen Einflussen (ESD, EMV)

Verfahren zum Isolieren und Verbinden der Schaltelemente des IC's

Datenblätter in deutscher und englischer Sprache

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

HALBLEITER- UND MIKROSYSTEMTECHNIK, Jahrgangsstufe 12

Lerngebiete: 12.1 Vergleich von Funktionseinheiten diskreter und integrierter Schaltungen II

12.2 Beschreibung von Mikrosystemen

27 Std. 54 Std. 81 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
12.1 Vergleich von Funktions- einheiten diskreter und integ- rierter Schaltungen II		In Verbindung mit dem LG 11.1 In diesem Lerngebiet soll die Technische Mathematik besonders berücksichtigt werden. 27 Std.
Die Schüler und Schülerinnen un- tersuchen die elektrische Wirkung von Schaltelementen diskreter und	Aufbau, Wirkungsweise und Eigenschaften passiver und aktiver Schaltelemente	
integrierter Schaltungen. Sie verwenden dazu Datenblätter in deut-	Bipolare und unipolare Technik	
scher und englischer Sprache. Sie bauen einfache Schaltungen der	Grundschaltungen der Verstärkertechnik	
Analog- und Digitaltechnik auf und erklären deren Funktion. Sie	Logische Grundschaltungen, Speicherzellen	

messen und dokumentieren die elektrischen Kenngrößen von Schaltelementen und Schaltungen, wie sie zur Prüfung von Wafern verwendet werden (Teststrukturen). Sie erklären den geometrischen und physikalischen Aufbau sowie dessen Einfluss auf die Eigenschaften der Schaltelemente. Sie bewerten die Stabilität der Schaltelemente. Sie beschreiben die erforderlichen Technologien, die beim Zusammenschalten einzelner Schaltelemente zum IC angewandt werden.

Bestimmung von Widerstand, Kapazität, Sperrstrom, Stromverstärkung, Steilheit, Schaltzeiten und Grenzfrequenz

Empfindlichkeit gegenüber physikalischen und chemischen Einflussen (ESD, EMV)

Verfahren zum Isolieren und Verbinden der Schaltelemente des IC's

Datenblätter in deutscher und englischer Sprache

12.2 Beschreibung von Mikrosystemen

54 Std.

Die Schüler und Schülerinnen beschreiben grundlegende Funktionen von Mikrosystemen und erkennen Sensoren, Aktoren, Signalaufbereitung und Schnittstellen als deren wesentliche Bestandteile. Sie beschreiben den Aufbau, die verschiedenen Funktionsprinzipien, Eigenschaften und Anwendungsbereiche ausgewählter Sensoren und Aktoren.

Einsatz von Mikrosystemen (z. B. Airbag)

Sensoren zur Erfassung von Temperatur, Durchflussmenge, Druck, Beschleunigung

Sensoren mit magnetempfindlichen und optoelektronischen Schaltelementen (z. B. für Drehzahl- und Füllstandsmessungen)

Aktoren (z. B. Mikromotor)

Schnittstellen zum makroskopischen Umfeld

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

FERTIGUNGSTECHNOLOGIE, Jahrgangsstufe 10

Lerngebiete: 10.1	Funktionsanalyse ausgewählter Halbleiterwerkstoffe	24 Std.
-------------------	--	---------

10.2Einhaltung von Reinraumbedingungen12 Std.10.3Anwendung von Standardsoftware48 Std.10.4Fertigstellung mikrotechnischer Produkte I36 Std.120 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
10.1 Funktionsanalyse ausgewählter Halbleiterwerkstoffe		24 Std.
Die Schüler und Schülerinnen unterscheiden zwischen den verschiedenen Leitungsmechanismen aus-	Leitungsvorgänge in Metallen, Halbleitern und Nichtleitern	
gewählter Werkstoffe. Sie können die grundlegenden Merkmale ele-	Polykristalline und einkristalline Halbleiter	
mentarer Halbleiter anhand des Periodensystems der Elemente ein-	Leitungsvorgänge in gestörten Halbleitern	
ordnen. Sie unterscheiden Halbleiterwerkstoffe und beschreiben	PN-Übergang	

deren Herstellung. Sie erklären den Einfluss von Fremdatomen auf die elektrischen Eigenschaften von Halbleitern. Sie untersuchen das Verhalten von Dioden in Abhängigkeit von der äußeren Spannung und schließen daraus auf die Vorgänge in der Sperrschicht.

10.2 Einhaltung von Reinraumbedingungen

12 Std.

Die Schüler und Schülerinnen erklären den Zusammenhang zwischen Luftreinhaltung und Produktionsausbeute. Sie sind in der Lage, die geforderten Reinraumbedingungen zu überwachen.

Reinraumklassifizierung

Ursachen, Arten und Auswirkungen von Verunreinigungen

Partikelmessung

Physikalische Anforderungen an die Belüftung (Durchsatz, Strömung, Druck, Temperatur, Feuchtigkeit)

Technische Maßnahmen zur Luftreinhaltung

Kontrollmessungen

10.3 Anwendung von Standardsoftware

48 Std.

Die Schüler und Schülerinnen be-Aufgaben eines Betriebssystems

schreiben ausgewählte Systemvoraussetzungen für den Einsatz von Standardsoftware und Peripheriegeräten. Sie wenden grundlegende Funktionen des installierten Betriebssystems an. Sie gestalten mit Hilfe von Standardsoftware Texte, Tabellen und grafische Darstellungen und verwenden diverse Softwarefunktionen zur Verwaltung von Dokumenten. Sie beschreiben und handhaben zeitgemäße Datenschutz- und Datensicherungskonzepte. Sie verstehen Erläuterungen in deutscher und englischer Sprache und beherrschen ausgewählte englischsprachige Befehle in Wort und Schrift.

Einsatz kommerzieller Software

Verwaltung von Daten

Backup-Methoden

Handreichungen, englischsprachige Anleitungen

10.4 Fertigstellung mikrotechnischer Produkte I

Die Schüler und Schülerinnen beschreiben die notwendigen Verfahren und erklären deren physikalische und chemische Prinzipien zur abschließenden Bearbeitung der Scheiben bis zum funktionsfähigen Endprodukt. Sie wählen Werkstoffe, Werkzeuge und Anlagen dazu aus. Sie kontrollieren und

Rückseitenprozesse

Trennen der Scheibe

Chipmontage, Bestückung

Kontaktierung

Häusen

In Verbindung mit dem LG 12.2 36 Std.

In dieser Jahrgangsstufe werden im wesentlichen Grundlagen der Metalltechnik behandelt.

dokumentieren elektrische und mechanische Eigenschaften. Sie analysieren Fehler und beschreiben die Möglichkeiten zu deren Beseitigung.

Funktionsprüfung

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologie/Mikrotechnologin

FERTIGUNGSTECHNOLOGIE, Jahrgangsstufe 11

Lerngebiete: 11.1 Anwendung fototechnischer Verfahren in der Mikrotechnologie 24 Std.

11.2 Erstellen von Schichten und deren Strukturierung
11.3 Einhaltung von Qualitätsstandards
36 Std.
36 Std.
36 Std.

11.4 Einstellung, Prüfung und Optimierung verfahrenstechnischer Anlagen I 24 Std.

120 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
11.1 Anwendung fototechnischer Verfahren in der Mikrotech-		In Verbindung mit dem Unterrichtsfach Chemische Prozesse
nologie		24 Std.
Die Schüler und Schülerinnen be- schreiben das fototechnische Ver- fahren als wesentliche Vorausset-	Physikalische und chemische Eigenschaften von Fotolacken	
zung zur Strukturierung von Mas- ken und Scheiben. Sie beschreiben	Belackungstechnik	
das Justieren der Masken, Belichten, Entwickeln und Entfernen von	Belichtungsverfahren	
Fotolacken. Außerdem beurteilen	Entwicklungsverfahren	

sie den fototechnischen Prozess anhand von Proben und bewerten das Gesamtergebnis. Sie vergleichen die Prinzipien fototechnischer Verfahren mit weiteren lithografischen Verfahren. Im Umgang mit Gefahrstoffen und der Entsorgung der Arbeitsstoffe halten sie die Bestimmungen des Gesundheits- und Umweltschutzes ein. Sie entnehmen Informationen aus Beschreibungen in englischer Sprache.

Reinigungsverfahren

Prüfverfahren

Beschreibungen in englischer Sprache

11.2 Erstellung von Schichten und deren Strukturierung

Die Schüler und Schülerinnen be-

schreiben die Verfahren zur Her-

stellung verschiedener Schichten

formulieren dazu die chemischen Reaktionsgleichungen. Zur Her-

stellung und Strukturierung von

Ergebnis der Schichtherstellung und Strukturierung anhand von

Mess- oder Prüfergebnissen und ziehen daraus Schlüsse für die wei-

tere Bearbeitung. Sie erklären die

Herstellung und Prüfung des Va-

Schichten wählen sie die erforderlichen Medien aus. Sie beurteilen das Verfahren zur Erzeugung von Oxydschichten, Nitridschichten, Polysiliziumschichten, Metallschichten, Epitaxieschichten und Widerstands-

schichten

sowie zu deren Strukturierung. Sie so formulieren dazu die chemischen

Strukturierung durch Nassätzen und Trocken-

ätzen

Einfluss des Vakuums auf den Prozess

Mess- und Prüfverfahren zur Schichtkontrolle

Bedienungsanleitungen in Deutsch und Eng-

lisch

In Verbindung mit dem Unterrichtsfach Chemische Prozesse 36 Std.

kuums. Im Umgang mit den Maschinen und Geräten beachten sie die Unfallverhütungsvorschriften. Beim Einsatz von Gefahrstoffen beachten sie die Vorschriften für den Umgang und die Entsorgung. Sie entnehmen Informationen aus englischsprachigen technischen Anleitungen.

11.3 Einhaltung von Qualitätsstandards

Die Schüler und Schülerinnen begründen die Bedeutung des Qualitätsmanagements. Sie stellen das Qualitätsmanagement eines (ihres) Betriebs dar. Sie berechnen und erläutern wichtige Kennwerte und Parameter der statistischen Prozessregelung. Sie leiten aus den Ergebnissen der statistischen Prozessregelung notwendige Änderungsmaßnahmen für den Fertigungsprozess ab.

11.4 Einstellung, Prüfung und Optimierung verfahrenstechnischer Anlagen I Kriterien zur Festlegung von Qualitätsstandards

Kundenorientierung

Maßnahmen des Qualitätsmanagements

Anforderungen an Mitarbeiter

Statistische Kenngrößen (Normalverteilung, Mittelwert, Standardabweichung)

Statistische Prozessregelung

36 Std.

In diesem Lerngebiet soll die Technische Mathematik besonders berücksichtigt werden.

In Verbindung mit dem LG 12.3

24 Std.

Die Schüler und Schülerinnen untersuchen die Wirkungsweise von Steuerungen und Regelungen an Beispielen verfahrenstechnischer Anlagen aus dem Fertigungsprozess. Sie nutzen Programme zur Simulation und Darstellung von Steuer- und Regelprozessen. Sie analysieren das Zeitverhalten von Reglern und Regelstrecken sowie deren Zusammenwirken im Regelkreis. Sie setzen Sensoren gezielt zur Messung prozessrelevanter Daten ein Sie wenden verschiedene Methoden zur Datenübertragung an. Die erfassten Messwerte werden von ihnen mit Hilfe der Computertechnik dargestellt und ausgewertet. Sie sind in der Lage, den Einfluss von Störgrößen auf den Fertigungsprozess zu erfassen, Fehler zu erkennen und ihr eigenes Handeln darauf einzurichten.

Steuerungen (z. B. Ablaufsteuerung)

Regelstrecken mit und ohne Ausgleich

Stetige Regler, unstetige Regler

Analoge und digitale Übertragung von Messdaten

Zusammenwirken von Regelstrecke und Regler (z. B. Temperaturregelung im Oxydationsofen, Durchflussmengenregelung von Gasen, Regelung des pH-Werts)

PC-gestützte Steuer- und Regelungstechnik

Fließbilder

Messprotokoll

Fehlerdiagnose

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologie/Mikrotechnologin

FERTIGUNGSTECHNOLOGIE, Jahrgangsstufe 12

Lerngebiete:

18 Std.

27 Std.

12.1 Veränderung der Leitfähigkeit durch Dotierungsverfahren
 12.2 Fertigstellung mikrotechnischer Produkte II
 12.3 Einstellung, Prüfung und Optimierung verfahrenstechnischer Anlagen II 45 Std.

90 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
12.1 Veränderung der Leitfähigkeit durch Dotie-		In Verbindung mit dem Unterrichsfach Chemische Prozesse
rungsverfahren		18 Std.
Die Schüler und Schülerinnen er-	Eigenschaften und Auswahl der Dotierstoffe	
klären die Wirkung des Dotierens auf die elektrische Leitfähigkeit.	(Wertigkeit, Diffusionskonstante, Löslichkeit)	
Sie begründen die Auswahl der Dotierstoffe. Sie erläutern die un-	Diffusionsverfahren, Diffusionsanlagen	
terschiedlichen Verfahren des Do-	Ionenimplantationsverfahren, Implan-	
tierens. Sie beurteilen Prozess- parameter und beschreiben deren	tationsanlagen	
Einfluss auf den Dotiervorgang.	Reaktionsgleichungen	

	Einfluss des Vakuums	
12.2 Fertigstellung mikrotechnischer Produkte II		In Verbindung mit dem LG 10.4 und dem Unterrichtsfach Chemische Prozesse 27 Std.
Die Schüler und Schülerinnen be- schreiben die notwendigen Verfah-	Rückseitenprozesse	
ren und erklären deren physikali- sche und chemische Prinzipien zur	Trennen der Scheibe	
abschließenden Bearbeitung der Scheiben bis zum funktionsfähigen	Chipmontage, Bestückung	
Endprodukt. Sie wählen Werkstoffe, Werkzeuge und Anlagen	Kontaktierung	
dazu aus. Sie kontrollieren und dokumentieren elektrische und	Häusen	
mechanische Eigenschaften. Sie analysieren Fehler und beschreiben die Möglichkeiten zu deren Be- seitigung.	Funktionsprüfung	
12.3 Einstellung, Prüfung und Optimierung verfahrens- technischer Anlagen II		In Verbindung mit LG 11.4
		45 Std.
Die Schüler und Schülerinnen untersuchen die Wirkungsweise von	Steuerungen (z. B. Ablaufsteuerung)	In diesem Lerngebiet soll die Technische Mathematik besonders berücksichtigt werden.
Steuerungen und Regelungen an Beispielen verfahrenstechnischer	Regelstrecken mit und ohne Ausgleich	
Anlagen aus dem Fertigungsprozess. Sie nutzen Programme zur	Stetige Regler, unstetige Regler	

Simulation und Darstellung von Steuer- und Regelprozessen. Sie analysieren das Zeitverhalten von Reglern und Regelstrecken sowie deren Zusammenwirken im Regelkreis. Sie setzen Sensoren gezielt zur Messung prozessrelevanter Daten ein. Sie wenden verschiedene Methoden zur Datenübertragung an. Die erfassten Messwerte werden von ihnen mit Hilfe der Computertechnik dargestellt und ausgewertet. Sie sind in der Lage, den Einfluss von Störgrößen auf den Fertigungsprozess zu erfassen, Fehler zu erkennen und ihr eigenes Handeln darauf einzurichten.

Analoge und digitale Übertragung von Messdaten

Zusammenwirken von Regelstrecke und Regler (z. B. Temperaturregelung im Oxydationsofen, Durchflussmengenregelung von Gasen, Regelung des pH-Werts)

PC-gestützte Steuer- und Regelungstechnik

Fließbilder

Messprotokoll

Fehlerdiagnose

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

CHEMISCHE PROZESSE, Jahrgangsstufe 10

Lerngebiet: 10.1 Beurteilung von chemischen Zusammenhängen für die Halbleiterherstellung

72 Std. 72 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
10.1 Beurteilung von chemischen Zusammenhängen für die Halbleiterherstellung		72 Std.
Die Schüler und Schülerinnen er- klären die Handhabung, Reakti- onsweise und das Gefahrenpotenti- al von chemischen Stoffen. Sie	Vorschriften der Gefahrstoffverordnung hinsichtlich Kennzeichnung und Handhabung von Chemikalien	
beachten Sicherheitsvorschriften und entsorgen chemische Abfall-	Periodensystem	
stoffe umweltgerecht. Sie stellen einfache Reaktionsgleichungen auf.	Säuren, Laugen, pH-Wert	
Sie führen Konzentrationsberechnungen durch und bestimmen	Kohlenstoffverbindungen, Alkohole	

den pH-Wert. Sie untersuchen die Wirkung ausgewählter Chemikalien und die daraus resultierenden Anforderungen an die in der Halbleitertechnik verwendeten Materialien. Sie erklären wichtige Verbindungen der organischen Chemie.

Lösemittel

Reaktive Gase und deren Spaltprodukte

Gewinnung von Reinstwasser und Wiederaufbereitung von Abwasser

Anforderungen an Rohre und Armaturen

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

CHEMISCHE PROZESSE, Jahrgangsstufe 11

11.1 Anwendung fototechnischer Verfahren in der Mikrotechnologie11.2 Erstellen von Schichten und deren Strukturierung Lerngebiete:

36 Std. 36 Std. 72 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
11.1 Anwendung fototechnischer Verfahren in der Mikrotech-		In Verbindung mit dem Unterrichtsfach Fertigungstechnologie
nologie		36 Std.
Die Schüler und Schülerinnen be- schreiben das fototechnische Ver- fahren als wesentliche Vorausset-	Physikalische und chemische Eigenschaften von Fotolacken	
zung zur Strukturierung von Mas- ken und Scheiben. Sie beschreiben	Belackungstechnik	
das Justieren der Masken, Belichten, Entwickeln und Entfernen von	Belichtungsverfahren	
Fotolacken. Außerdem beurteilen sie den fototechnischen Prozess anhand von Proben und bewerten	Reinigungsverfahren Entwicklungsverfahren	

das Gesamtergebnis. Sie vergleichen die Prinzipien fototechnische Verfahren mit weiteren lithografischen Verfahren. Im Umgang mit Gefahrstoffen und der Entsorgung der Arbeitsstoffe halten sie die Bestimmungen des Gesundheits- und Umweltschutzes ein. Sie entnehmen Informationen aus Beschreibungen in englischer Sprache

Prüfverfahren Beschreibungen in englischer Sprache

11.2 Erstellung von Schichten und deren Strukturierung

Die Schüler und Schülerinnen be-

schreiben die Verfahren zur Herstellung verschiedener Schichten sowie zu deren Strukturierung. Sie formulieren dazu die chemischen Reaktionsgleichungen. Zur Herstellung und Strukturierung von Schichten wählen sie die erforderlichen Medien aus. Sie beurteilen das Ergebnis der Schichtherstellung und Strukturierung anhand von Mess- oder Prüfergebnissen und ziehen daraus Schlüsse für die weitere Bearbeitung. Sie erklären die Herstellung und Prüfung des Vakuums. Im Umgang mit den Ma-

schinen und Geräten beachten sie

Verfahren zur Erzeugung von Oxydschichten, Nitridschichten, Polysiliziumschichten, Metallschichten, Epitaxieschichten und Widerstandsschichten

Strukturierung durch Nassätzen und Trockenätzen

Einfluss des Vakuums auf den Prozess

Mess- und Prüfverfahren zur Schichtkontrolle

Bedienungsanleitungen in Deutsch und Englisch

In Verbindung mit dem Unterrichtsfach Fertigungs-technologie 36 Std.

die Unfallverhütungsvorschriften. Beim Einsatz von Gefahrstoffen beachten sie die Vorschriften für den Umgang und die Entsorgung. Sie entnehmen Informationen aus englischsprachigen technischen Anleitungen.

Berufsschule

Fachklassen Mikrotechnologe/Mikrotechnologin

CHEMISCHE PROZESSE, Jahrgangsstufe 12

12.1 Veränderung der Leitfähigkeit durch Dotierungsverfahren
12.2 Fertigstellung mikrotechnischer Produkte III Lerngebiete:

36 Std.

18 Std. 54 Std.

LERNZIELE	LERNINHALTE	HINWEISE ZUM UNTERRICHT
12.1 Veränderung der Leitfähig-		In Verbindung mit dem Unterrichtsfach Fertigungstechnologie
keit durch Dotierungsver- fahren		36 Std.
Die Schüler und Schülerinnen er-	Eigenschaften und Auswahl der Dotierstoffe	
klären die Wirkung des Dotierens auf die elektrische Leitfähigkeit.	(Wertigkeit, Diffusionskonstante, Löslichkeit)	
Sie begründen die Auswahl der Dotierstoffe. Sie erläutern die un-	Diffusionsverfahren, Diffusionsanlagen	
terschiedlichen Verfahren des Do-	Ionenimplantationsverfahren, Implan-	
tierens. Sie beurteilen Prozess- parameter und beschreiben deren	tationsanlagen	
Einfluss auf den Dotiervorgang.	Reaktionsgleichungen	

Einfluss des Vakuums

12.2 Fertigstellung mikrotechnischer Produkte III

Die Schüler und Schülerinnen beschreiben die notwendigen Verfahren und erklären deren physikalische und chemische Prinzipien zur abschließenden Bearbeitung der Scheiben bis zum funktionsfähigen Endprodukt. Sie wählen Werkstoffe, Werkzeuge und Anlagen dazu aus. Sie kontrollieren und dokumentieren elektrische und mechanische Eigenschaften. Sie analysieren Fehler und beschreiben die Möglichkeiten zu deren Beseitigung.

Rückseitenprozesse

Trennen der Scheibe

Chipmontage, Bestückung

Kontaktierung

Häusen

Funktionsprüfung

In Verbindung mit dem Unterrichtsfach Fertigungstechnologie 18 Std.

Anlage

Die Mitglieder der Lehrplankommission waren:

Gerhard Bielesch Regensburg
Dr. Werner Kusch ISB München
Günter Kirchberger Regensburg